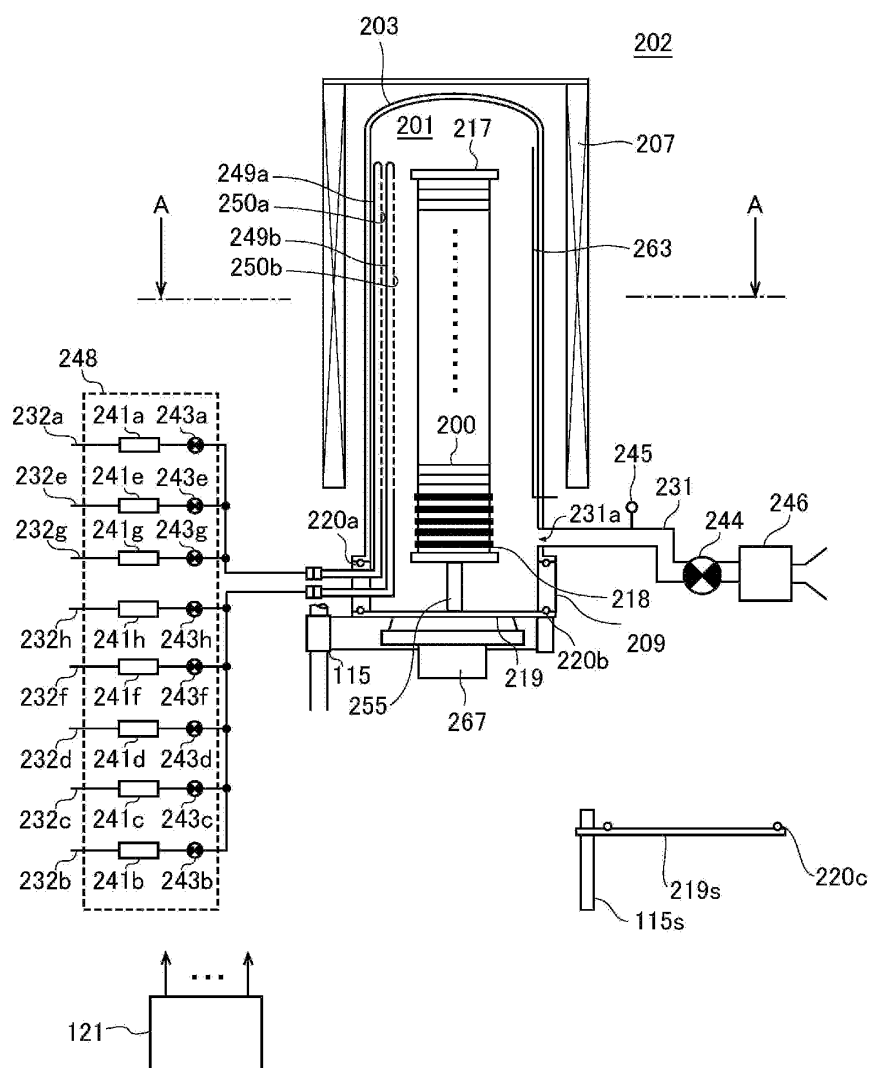
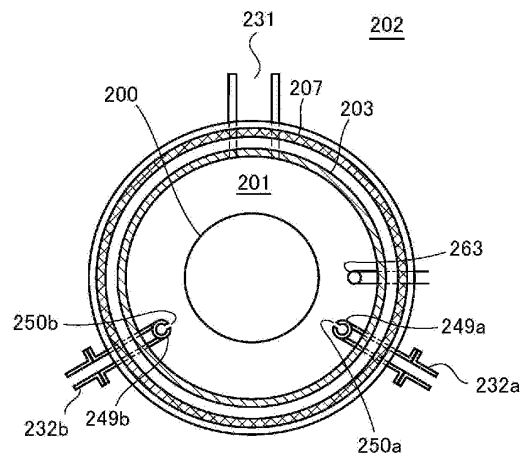


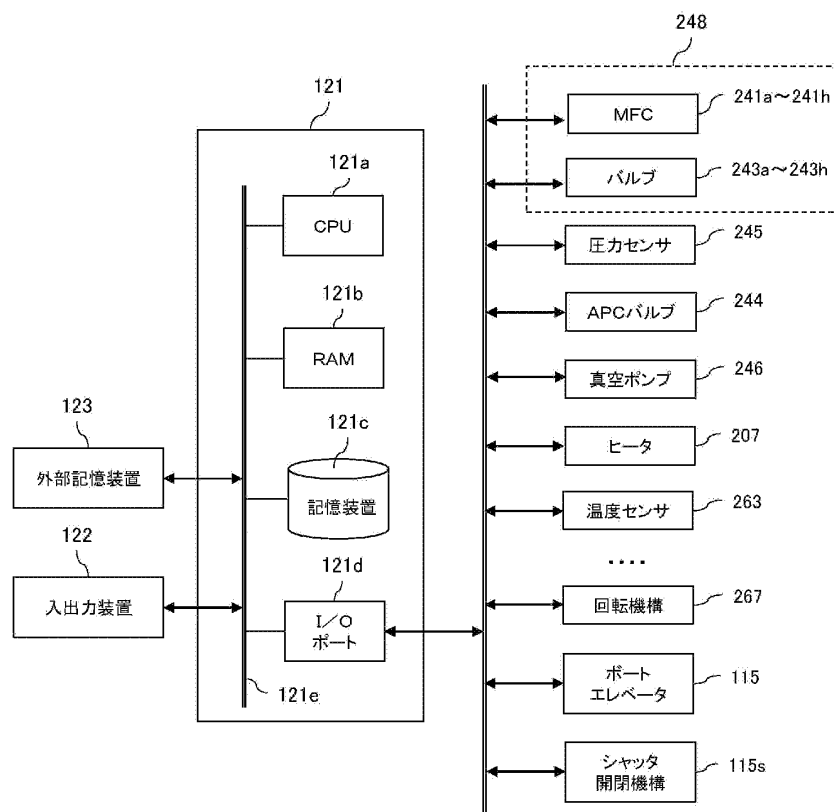
[図1]



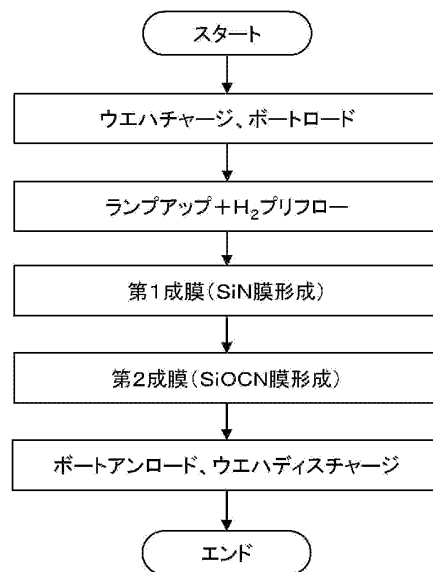
[図2]



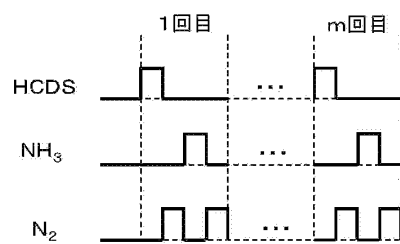
[図3]



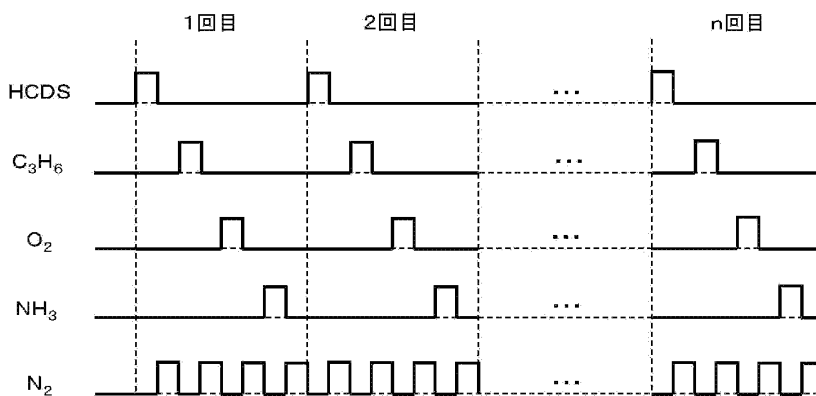
【図4】



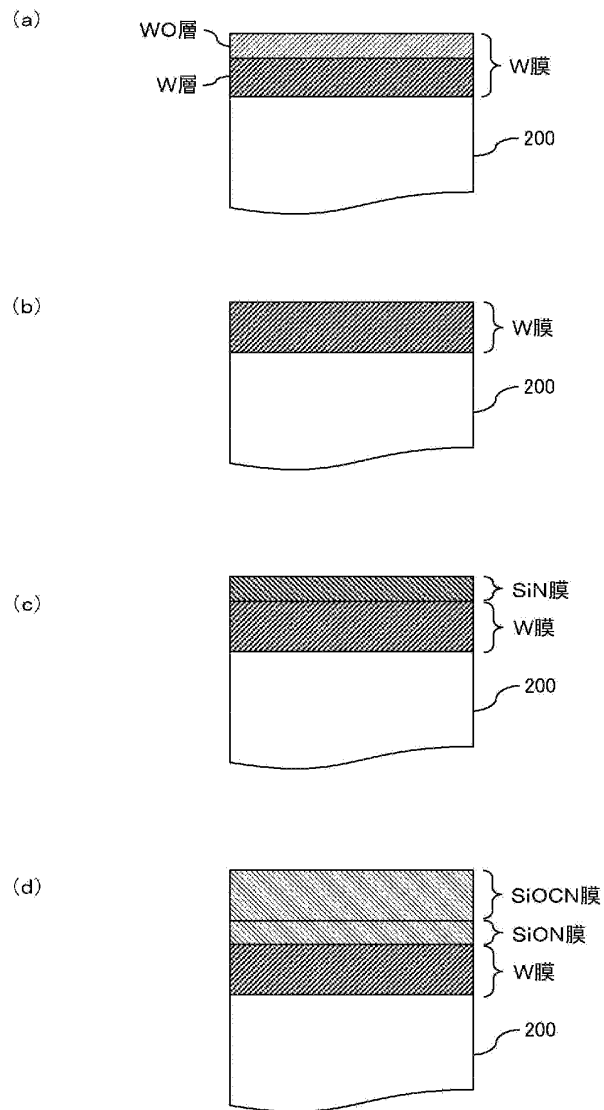
【図5】



【図6】



[図7]



[図8]

	ランブアップ + H ₂ プリフロー	SiN膜の 厚さ(nm)	SiOCN膜 の厚さ(nm)	(W層の厚さ/ W膜の厚さ) × 100%	(WO層の厚さ /W膜の厚さ) × 100%
初期状態	-	-	-	70	30
サンプル1	実施	0	7	98.84	1.16
サンプル2	実施	0.16	6.84	100	0
サンプル3	実施	0.32	6.68	100	0
サンプル4	実施	0.48	6.52	100	0
サンプル5	実施	1.00	6.00	100	0